发射区 基区 集电区 n

◆第1-2讲习题

1.计算随C-B结电压变化,中性基区宽度的变化。考虑均匀掺杂的硅双极晶体管,T=300K,基区掺杂浓度为 $N_B=5\times10^{16}cm^{-3}$,集电区掺杂浓度为 $N_C=2\times10^{15}cm^{-3}$ 。假定冶金结宽度为 $0.70\mu m$ 。计算C-B结电压从2V变化到10V时,中性基区宽度的变化。

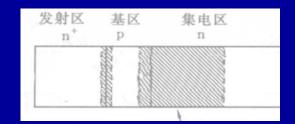
解:

集电结在基区中的宽度为

$$X_{dB} = \left\{ \frac{2\varepsilon_{s}(V_{bi} + V_{CB})}{q} \left[\frac{N_{C}}{N_{B}} \frac{1}{N_{B} + N_{C}} \right] \right\}^{1/2}$$

代入数据得到

$$\begin{split} X_{dB} &= \left\{ \frac{2 \times 11.7 \times 8.85 \times 10^{-12} (V_{bi} + V_{CB})}{1.6 \times 10^{-19}} \left[\frac{2 \times 10^{15}}{5 \times 10^{16}} \times \frac{1}{2 \times 10^{15} \times 10^{6} + 5 \times 10^{16} \times 10^{6}} \right] \right\}^{1/2} \\ &= \left\{ (9.96 \times 10^{-16}) (V_{bi} + V_{CB}) \right\}^{1/2} \end{split}$$



内建电势差为

$$V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_B N_C}{n_i^2} \right) = 0.697 \text{V}$$

因为B-E结正偏,所以发射结耗尽层较小,将其忽略,则可计算出中性基区宽度 x_B 为

$$W_{CB} = 2VH$$
 $x_B = 0.70 - 0.052 = 0.648 \mu m$

所以当C-B结电压从2V变化到10V时,中性基区宽度从0.648μm 变化到0.597μm。

- ◆第1-2讲习题
- 2.以下列参数计算一个硅双极晶体管在T=300K时的共发射极电

流增益。

$$D_E = 10 \text{ cm}^2/\text{s}$$
 $x_B = 0.70 \,\mu\text{m}$
 $D_B = 25 \text{ cm}^2/\text{s}$ $x_E = 0.50 \,\mu\text{m}$
 $\tau_{E0} = 1 \times 10^{-7} \text{ s}$ $N_E = 1 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$
 $\tau_{B0} = 5 \times 10^{-7} \text{ s}$ $N_B = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$
 $J_{r0} = 5 \times 10^{-8} \text{ A/cm}^2$ $V_{BE} = 0.65 \text{ V}$

解:

首先求共基极电流增益 α_{0} , α_{0} = α_{T} γ

$$\alpha_T = \frac{I_{nC}}{I_{nE}} = \operatorname{sech}\left(\frac{W_b}{L_{nb}}\right) \approx 1 - \frac{W_b^2}{2L_{nb}^2}$$

$$\gamma = \frac{I_{nE}}{I_E} = \frac{1}{1 + \frac{D_{pe}}{D_{nb}} \frac{p_{ne0}}{n_{pb0}} \frac{W_b}{L_{pe}}}$$

计算一些必要的参数

参数计算如下:

$$p_{E0} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{1 \times 10^{18}} = 2.25 \times 10^2 \text{ cm}^{-3}$$

$$n_{B0} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{1 \times 10^{16}} = 2.25 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

$$L_E = \sqrt{D_E \tau_{E0}} = 10^{-3} \text{ cm}$$

$$L_B = \sqrt{D_B \tau_{B0}} = 3.54 \times 10^{-3} \text{ cm}$$

将计算得到的参数代入ατγ的表达式

$$\alpha_T = \frac{I_{nC}}{I_{nE}} = \operatorname{sech}\left(\frac{W_b}{L_{nb}}\right) \approx 1 - \frac{W_b^2}{2L_{nb}^2} = 1 - \frac{(0.7 \times 10^{-4})^2}{2 \times (3.54 \times 10^{-3})^2} = 0.9998$$

$$\gamma = \frac{I_{nE}}{I_E} = \frac{1}{1 + \frac{D_{pe}}{D_{nb}} \frac{p_{ne0}}{n_{pb0}} \frac{W_b}{L_{pe}}} = \frac{1}{1 + \frac{10}{25} \times \frac{2.25 \times 10^2}{2.25 \times 10^4} \times \frac{0.7 \times 10^{-4}}{10^{-3}}} = 0.9997$$

所以, $\alpha_0 = \alpha_T \gamma = 0.9998 \times 0.9997 = 0.9995$

接着利用 α_0 求共发射极电流增益 β_0

$$\beta_0 = \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_0} = \frac{0.9995}{1 - 0.9995} = 1999$$

◆第1-2讲习题

3.试确定发射区掺杂浓度与基区浓度之比,以使发射极注入效率系数达到 γ =0.9967。设想是一个npn型双极晶体管。为了简化计算,假定 D_E = D_B , L_E = L_B , x_E = x_B 。

解:

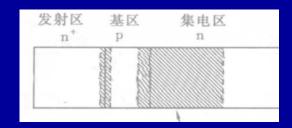
$$\gamma = \frac{I_{nE}}{I_{E}} = \frac{1}{1 + \frac{D_{pe}}{D_{nb}} \frac{p_{ne0}}{n_{pb0}} \frac{W_{b}}{L_{pe}}}$$

$$\gamma = \frac{I_{nE}}{I_E} = \frac{1}{1 + \frac{D_{pe}}{D_{nb}} \frac{p_{ne0}}{n_{pb0}} \frac{W_b}{L_{pe}}} = \frac{1}{1 + \frac{D_E}{D_B} \frac{n_i^2/N_E}{n_i^2/N_B} \frac{W_b}{L_{pe}}} = \frac{1}{1 + \frac{D_E}{D_B} \frac{N_B}{N_E} \frac{W_b}{L_{pe}}}$$

代入题中已知条件,可得

$$\frac{N_E}{N_B} = 302$$

◆第1-2讲习题



4.试确定集电区掺杂浓度和集电区宽度,以满足穿通电压的要求。 假设有一均匀掺杂的硅双极晶体管,基区宽度为0.5µm,基区掺 杂浓度为 $N_B=10^{16}$ cm⁻³。穿通电压期望值为 $V_{pt}=25$ V。

解:

穿通电压表达式为
$$V_{pT} \simeq \frac{q}{2\epsilon_s} \frac{N_B}{N_C} (N_B + N_C) W_B^2$$

代入题中已知的数据

$$25 = \frac{1.6 \times 10^{-19}}{2 \times 11.7 \times 8.85 \times 10^{-12}} \times 10^{2} \times \frac{10^{16}}{N_{C}} \times (10^{16} + N_{C}) \times (0.5 \times 10^{-4})^{2}$$

解得集电区掺杂浓度为

$$N_C = 8.38 \times 10^{14} cm^{-3}$$

集电区的n型掺杂浓度必须保证集电结在集电区一侧的耗尽层小

于集电区的宽度,这样集电区才不会被穿通

集电结耗尽区在集电区中的宽度为

$$x_n = \left[\frac{2\varepsilon_s(V_{bi} + V_R)}{q} \left(\frac{N_B}{N_C} \frac{1}{N_B + N_C}\right)\right]^{1/2}$$

将 $V_R=V_{pt}$ 代入并忽略 V_{bi} ,可得

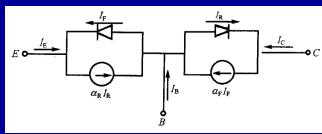
$$x_n = \left[\frac{2\times 11.7\times 8.85\times 10^{-14}\times 25}{1.6\times 10^{-19}}\times \left(\frac{10^{16}}{8.38\times 10^{14}}\times \frac{1}{10^{16}+8.38\times 10^{14}}\right)\right]^{1/2} = 5.97\mu m$$

所以集电区最小宽度为5.97μm

- ◆第3-4讲习题
- 1.一个npn型双极晶体管工作在有源区。运用E-M模型,试将基

极电流 I_B 用 α_{F_r} α_{R_r} I_{FO_r} I_{RO} 和 V_{BE} 表示出来。解:

E-M模型的基本方程



$$I_{E}$$
= - $I_{F0}[exp(qV_{BE}/kT)-1] + \alpha_{R} I_{R0}[exp(qV_{BC}/kT)-1]$

$$I_{C} = -I_{R0}[exp(qV_{BC}/kT)-1] + \alpha_{F}I_{F0}[exp(qV_{BE}/kT)-1]$$

根据E-M模型等效电路可以得到

$$I_{B} = - \left(I_{E} + I_{C} \right) = - \left\{ (\alpha_{F} I_{F0} - I_{F0}) \left[exp \left(\frac{q V_{BE}}{k T} \right) - 1 \right] + (\alpha_{R} I_{R0} - I_{R0}) \left[exp \left(\frac{q V_{BC}}{k T} \right) - 1 \right] \right\}$$

本题有源区即为放大区, $V_{BC} < 0$,对上式做近似得到

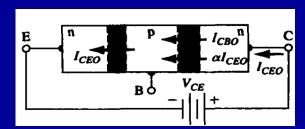
$$I_{B} = -\left\{ \left(\alpha_{F}I_{F0} - I_{F0}\right) \left[exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1\right] - \left(\alpha_{R}I_{R0} - I_{R0}\right)\right\}$$

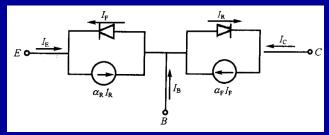
- ◆第3-4讲习题
- 2.考虑E-M模型,将基极悬空,以便使 $I_B=0$ 。证明,当施加B-E

结电压 V_{BE} 时,有 $I_C = I_{CEO} = I_{RO} \frac{1-\alpha_F\alpha_R}{1-\alpha_F}$ 解:

$$I_E = -I_{F0}[exp(qV_{BE}/kT)-1] + \alpha_R I_{R0}[exp(qV_{BC}/kT)-1]$$

$$I_{C} = -I_{R0}[exp(qV_{BC}/kT)-1] + \alpha_{F}I_{F0}[exp(qV_{BE}/kT)-1]$$





当 $I_R=0$ 时,根据E-M模型的等效电路图得

$$I_E = -I_C$$



$$-I_{F0}\left[exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right)-1\right]+\alpha_{R}I_{R0}\left[exp\left(\frac{qV_{BC}}{kT}\right)-1\right]=I_{R0}\left[exp\left(\frac{qV_{BC}}{kT}\right)-1\right]-\alpha_{F}I_{F0}\left[exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right)-1\right]$$

$$V_{BC}$$
<0

$$\left[exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1\right] = \frac{(\alpha_R - 1)I_{R0}}{\alpha_F I_{F0} - I_{F0}}$$

代入 I_c 的表达式,并考虑 V_{BC} <0做近似

$$I_C = I_{R0} \frac{1 - \alpha_F \alpha_R}{1 - \alpha_F}$$

- ◆第3-4讲习题
- 3.考虑一个npn型硅晶体管, T=300K。假设其参数如下:

$$I_E = 0.5 \text{ mA}$$
 $C_{je} = 0.8 \text{ pF}$
 $x_B = 0.7 \mu\text{m}$ $D_n = 25 \text{ cm}^2/\text{s}$
 $x_{dc} = 2.0 \mu\text{m}$ $r_c = 30 \Omega$
 $C_{jc} = 0.08 \text{ pF}$ $\beta_0 = 50$

分别计算特征频率 f_T 和截止频率 f_β 。

解:

特征频率行的表达式为

$$f_T = \beta_0 f_\beta = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\tau_F + \frac{kT}{qI_C} C_{jE} + (\frac{kT}{qI_C} + r_C) C_{jC}}$$

利用题中已知参数计算行表达式分母中的未知参量

$$\tau_F = \tau_B = \frac{x_B^2}{2D_n} = \frac{(0.7 \times 10^{-4})^2}{2 \times 25} = 9.8 \times 10^{-11} s$$

$$I_C = \beta_0 I_B = 50 I_B$$

$$I_C + I_B = I_E = 0.5 \times 10^{-3} A$$



 $I_C = 0.49 \times 10^{-3} A$

将计算得到的参量及题中已知的参数代入疗的表达式

$$f_T = \frac{1}{2\pi} \times \frac{1}{9.8 \times 10^{-11} + \frac{0.026}{0.49 \times 10^{-3}} \times 0.8 \times 10^{-12} + \left(\frac{0.026}{0.49 \times 10^{-3}} + 30\right) \times 0.08 \times 10^{-12}} = 1.08 \times 10^9 \text{Hz}$$

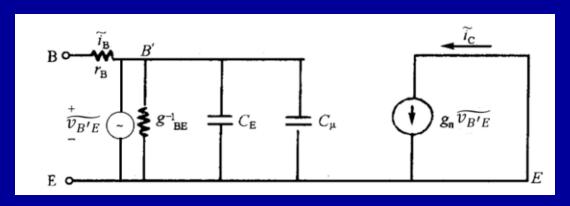
截止频率fβ为

$$f_{\beta} = \frac{f_T}{\beta_0} = \frac{1.08 \times 10^9}{50} = 2.16 \times 10^7 \text{Hz}$$

- ◆第3-4讲习题
- 4.试确定小信号电流增益 β 下降到其低频的 $1/\sqrt{2}$ 时的频率。所有用到的物理量均用课件上的符号表示,只需算出表达式,不需算出具体数值。

解:

利用高频小信号等效电路求出电流增益β与频率的关系



$$\beta = \frac{\frac{g_m}{C_E + C_{\mu}}}{\frac{g_{BE}}{C_E + C_{\mu}} + j\omega} = \frac{\frac{g_m}{g_{BE}}}{1 + j\omega \frac{C_E + C_{\mu}}{g_{BE}}} = \frac{\beta_0}{1 + j\omega/\omega_{\beta}} = \frac{\beta_0}{1 + jf/f_{\beta}}$$

$$\beta_0 = \frac{g_m}{g_{BE}}$$

$$\omega_{\beta} = \frac{g_{BE}}{C_E + C_{\mu}}$$

$$f_{\beta} = \frac{1}{2\pi} \omega_{\beta}$$

所以电流增益
$$\beta$$
的大小为 $|\beta| = \beta_0 / \sqrt{1 + (f/f_{\beta})^2}$

当 β 下降到 $\beta_0/\sqrt{2}$ 时 $f=\overline{f_\beta}$

因为 f_{β} 和 ω_{β} 间的关系为

$$f_{\beta} = \frac{1}{2\pi} \,\omega_{\beta}$$

 ω_{β} 的表达式为

$$\omega_{\beta} = \frac{g_{BE}}{C_E + C_{\mu}}$$

所以f。的表达式为

$$f_{\beta} = \frac{1}{2\pi} \omega_{\beta} = \frac{1}{2\pi} \frac{g_{BE}}{C_E + C_{\mu}}$$

- ◆第3-4讲习题
- 5.一个npn型硅双极晶体管的面积为 10^{-3} cm 2 , T=300K, 中性基区宽度为 $1\mu m$, 掺杂浓度分别 $N_E=10^{18}$ cm $^{-3}$, $N_B=10^{17}$ cm $^{-3}$, $N_C=10^{16}$ cm $^{-3}$ 。其他参数为D=20cm 2 /s, $\tau_{E0}=\tau_{B0}=10^{-7}$ s, $\tau_{C0}=10^{-6}$ s。假设晶体管工作在正向有源区。计算三种情况下的集电极电流: $(a)V_{BE}=0.5$ V, $(b)I_E=1.5$ mA, $(c)I_B=2\mu$ A(计算涉及到的载流子扩散系数均用D)

解:

(a)正向有源状态下集电极电流 I_c 的表达式为

$$I_C = \frac{qAD_{nb}n_{pb0}}{W_b} \left[exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right] - qA\left(\frac{D_{nb}n_{pb0}}{W_b} + \frac{D_{pc}p_{nc0}}{L_{pc}}\right)$$

利用题中已知条件计算Ic表达式中的未知参数

$$n_{pb0} = \frac{n_i^2}{N_B} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{10^{17}} = 2.25 \times 10^3 cm^{-3}$$

$$p_{nc0} = \frac{n_i^2}{N_C} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{10^{16}} = 2.25 \times 10^4 cm^{-3}$$

$$L_{pc} = \sqrt{D\tau_{c0}} = \sqrt{20 \times 10^{-6}} = 0.0045cm$$

将数据全部代入 I_C 表达式中,得到 I_C 的值

$$I_{C} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 10^{-7} \times 20 \times 10^{-4} \times 2.25 \times 10^{9}}{10^{-6}} \times \left[exp\left(\frac{0.5}{0.026}\right) - 1 \right] - 1.6 \times 10^{-19} \times 10^{-7} \times \left(\frac{20 \times 10^{-4} \times 2.25 \times 10^{9}}{10^{-6}} + \frac{20 \times 10^{-4} \times 2.25 \times 10^{10}}{4.5 \times 10^{-5}} \right) = 16.2 \mu A$$

(b)已知 $I_E = 1.5 \text{mA}$,求 I_C

$$I_E = -qA\left(\frac{D_{nb}n_{pb0}}{W_b} + \frac{D_{pe}p_{ne0}}{L_{pe}}\right)\left[exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1\right] - \frac{qAD_{nb}n_{pb0}}{W_b}$$

对I。取绝对值,代入数据



$$V_{BE}=0.6176V$$

代入到Ic的表达式中



$$I_C = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 10^{-7} \times 20 \times 10^{-4} \times 2.25 \times 10^{9}}{10^{-6}} \times \left[exp\left(\frac{0.6176}{0.026}\right) - 1\right] - 1.6 \times 10^{-19} \times 10^{-7} \times \left(\frac{20 \times 10^{-4} \times 2.25 \times 10^{9}}{10^{-6}} + \frac{20 \times 10^{-4} \times 2.25 \times 10^{10}}{4.5 \times 10^{-5}}\right) = 1.49 mA$$

(c)已知 $I_B = 2\mu A$,求 I_C

利用题中条件先求共基极电流增益。

$$\alpha_0 = \alpha_T \gamma = \left(1 - \frac{W_b^2}{2L_{nb}^2}\right) \left(1 + \frac{D_{pe}}{D_{nb}} \frac{p_{ne0}}{n_{pb0}} \frac{W_b}{L_{pe}}\right)^{-1}$$

代入数据可得到α。的值为

$$\alpha_0 = \left(1 - \frac{1}{2 \times 200}\right) \times \left(1 + 1 \times \frac{10^{17}}{10^{18}} \times \frac{1}{14.1}\right)^{-1} = 0.9905$$

利用 α_0 与 β_0 间的关系求 β_0 的值

$$\beta_0 = \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_0} = \frac{0.9905}{1 - 0.9905} = 104.26$$

因为
$$\frac{I_C}{I_R} = \beta_0$$
,所以 I_C 的值为

$$I_C = 104.26 \times 2 = 208.52 \mu A$$

◆第5讲习题

1.(a)如果由于制造的误差,一组晶体管的中性基区宽度变化范围为 $0.800 \le x \le 1.00 \mu m$,计算基区输运系数 α_T 的变化范围。假定 $L_B=1.414 \times 10^{-3} cm$ 。(b)用(a)中的计算结果,假定 $\gamma=0.9967$,计算共发射极电流增益的变化范围。

解:

(a) α_T 的表达式可以写成

$$\alpha_T = \frac{I_{nC}}{I_{nE}} = \operatorname{sech}\left(\frac{x}{L_B}\right) \approx 1 - \frac{x^2}{2L_B^2}$$

将 L_B 及x的取值范围代入,可得到 α_T 的变化范围为

 $0.9975 \le \alpha_T \le 0.9984$

(b) 要计算共发射极电流增益可以先计算共基极电流增益

因为有
$$\alpha_0 = \alpha_T \gamma$$

所以若 $\gamma=0.9967$,则 α_0 的变化范围为

$$0.9942 \le \alpha_0 \le 0.9951$$

共发射极电流增益β。与共基极电流增益α。之间存在以下关系

$$\beta_0 = \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_0}$$

将αο的变化范围代入上式可以得到βο的变化范围为

 $171.41 \le \beta_0 \le 203.08$

- ◆第5讲习题
- 2. 假定一个npn型双极晶体管在T=300K时的少子参数如下:

$$D_E$$
=8cm²/s , D_B =20cm²/s , D_C =12cm²/s , τ_{E0} =10-8s , τ_{B0} =10-7s , τ_{C0} =10-6s。若发射区掺杂浓度为 N_E =5×10¹⁸cm-3 , 确定基区掺杂浓度,使得 γ =0.9950。假设 x_E =2 x_B =2 μ m。

解:

基区电子扩散长度为

$$L_{nb} = \sqrt{D_B \tau_{B0}} = \sqrt{20 \times 10^{-7}} \times 10^4 = 14.1 \mu m$$

 L_{nb} 远大于 x_B , 所以 γ 的表达式可以写成

$$\gamma = \frac{1}{1 + \frac{D_E}{D_B} \frac{N_B}{N_E} \frac{W_b}{L_{pe}}}$$

将题中相关数据代入可得

$$0.9950 = \frac{1}{1 + \frac{8}{20} \times \frac{N_B}{5 \times 10^{18}} \times \frac{10^{-4}}{\sqrt{8 \times 10^{-8}}}}$$

解上面方程式可得基区掺杂浓度为

$$N_B = 1.8 \times 10^{17} cm^{-3}$$

- ◆第5讲习题
- 3.硅双极晶体管的基区宽度为 W_B =0.80 μ m。基区和集电区的掺杂浓度分别为 N_B = 2×10^{16} cm⁻³和 N_C = 2×10^{15} cm⁻³。试计算穿通击穿电压。

解:

穿通击穿电压表示为

$$V_{\rm pT} \simeq \frac{q}{2\epsilon_{\rm s}} \frac{N_{\rm B}}{N_{\rm C}} (N_{\rm B} + N_{\rm C}) W_{\rm B}^2$$

将题中给出的数据代入试中可得穿通击穿电压的值为

$$V_{pt} = \frac{1.6 \times 10^{-19}}{2 \times 11.7 \times 8.85 \times 10^{-12}} \times 10^2 \times \frac{2 \times 10^{16}}{2 \times 10^{15}} \times (2 \times 10^{16} + 2 \times 10^{15}) \times (0.80 \times 10^{-4})^2 = 109V$$

所以穿通击穿电压为109V

◆第5讲习题

4.考虑一个npn型双极晶体管,其基区中的参数如下: D_n =20cm²/s, n_{B0} =10⁴cm⁻³ , x_B =1 μ m , A_{BE} =10⁻⁴cm² 。 计 算 (i) v_{BE} =0.5V,(ii) v_{BE} =0.7V三种情况下的集电极电流。

解:

适用于任何工作状态下的集电极电流的表达式为

$$I_C = a_{21} \left[\exp\left(\frac{qV_{be}}{kT}\right) - 1 \right] + a_{22} \left[\exp\left(\frac{qV_{bc}}{kT}\right) - 1 \right]$$

本题考虑晶体管工作在放大状态,做近似可将 I_c 的表达式重新书写为

$$I_{C} = \frac{qAD_{nb}n_{pb0}}{W_{b}} \left[exp\left(\frac{qV_{BE}}{kT}\right) - 1 \right]$$

利用题中给出的数据可以计算

$$\frac{qA_{BE}D_nn_{B0}}{x_B} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 10^{-8} \times 20 \times 10^{-4} \times 10^{10}}{10^{-6}} = 3.2 \times 10^{-14}A$$

(i)当 v_{BE} =0.5V时, I_C 为

$$I_C = 3.2 \times 10^{-14} \times \left[exp\left(\frac{0.5}{0.026}\right) - 1 \right] = 7.19\mu A$$

(ii) 当 v_{BE} =0.6V时, I_C 为

$$I_C = 3.2 \times 10^{-14} \times \left[exp\left(\frac{0.6}{0.026}\right) - 1 \right] = 337\mu A$$

(iii) 当 v_{BE} =0.7V时, I_C 为

$$I_C = 3.2 \times 10^{-14} \times \left[exp\left(\frac{0.7}{0.026}\right) - 1 \right] = 15800\mu A$$

◆第5讲习题

5.在一个特殊的双极晶体管中,基区渡越时间占总时间的20%。基区宽度为 $0.5 \mu m$,基区扩散系数为 $D_{B}=20 cm^2/s$ 。试确定截止频率。

解:

特征频率行的表达式为

$$f_T = \beta_0 f_{\beta} = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\tau_F + \frac{kT}{qI_C} C_{jE} + (\frac{kT}{qI_C} + r_C) C_{jC}}$$

表达式中的三项之和为总时间常数,且 $\tau_F \approx \tau_B$, τ_B 可以通过下面式子求得

$$\tau_B = \frac{W^2}{2D_B} = \frac{(0.5 \times 10^{-4})^2}{2 \times 20} = 6.25 \times 10^{-11} s$$

由题意可得总时间常数为

$$\tau = \frac{6.25 \times 10^{-11}}{0.2} = 3.125 \times 10^{-10} s$$

所以可以计算得到特征频率fr的值为

$$f_T = \frac{1}{2\pi} \times \frac{1}{3.125 \times 10^{-10}} = 509$$
MHz

所以截止频率表示为

$$f_{\beta} = \frac{f_T}{\beta_0} = \frac{509 \text{MHz}}{\beta_0}$$

关于作业的几点建议

- ◆ 答题要规范, 书写要工整
- ◆ 必要的公式一定要写出来, 计算务必细心
- ◆ 必须的文字说明不能少,解题过程思路要清晰
- ◆ 做作业态度要摆正
- ◆ 鼓励和同学讨论问题,但是作业一定要按照自 己的思路做一遍
- ◆作业拍照之后尽量贴入word文档,每次作业上 传一个文档,不要上传若干张图片